

PICOSUN™ P-300BV

PICOSUN™ P-300BV ALD系統專用於生產LED、分立器件及印表機列印頭、感測器和麥克風等MEMS元件。



技術特徵

PICOSUN™ P-300 ALD系統的出現重新定義了ALD高產量製造標準。我們將經專利註冊的熱腔壁設計與完全獨立的前驅物管線結合，可高產量製造出低微粒、電學和光學性能優越的頂級ALD薄膜。設計靈活，維護輕鬆、快捷，使得該系統成為市場上停運時間最短、運作成本最低的ALD系統。

另外，我們具備擴散增強專利技術Picoflow™，能通過各種製程驗證，在超高深寬比基體表面製造出高度適形塗層。

PICOSUN™ P-300BV ALD系統代表了工業化ALD尖端工藝水準，用於半自動化批量加工晶片。該系統經優化實現快速量產，並可通過SECS/GEM選件整合到工廠自動化設備中。具備加熱功能的真空裝載系統能保證靈敏基板處理過程的清潔及金屬氮化物等材料的沉積。

綜上所述，PICOSUN™ P-300BV ALD系統是創新技術的首選。

典型基板尺寸和類型

- 200 mm晶片，每批25片，採用標準間距
- 150 mm晶片，每批50片，採用標準間距
- 100 mm晶片，每批75片，採用標準間距
- 非晶片基板（定制支撐架）
- 高深寬比（最高達1:2500）樣件

製程溫度

- 50到450°C

典型製程

- 週期時間低至幾秒*的批量加工製程
- Al_2O_3 、 SiO_2 、 Ta_2O_5 、 HfO_2 、 ZnO 、 TiO_2 、 ZrO_2 、 AlN 、 TiN 和各種金屬
- 同一批中，非均勻性低至1% 1σ 以下（ Al_2O_3 ，WIW，WTW，B2B，49 pts，5mm EE）**

基板裝載

- 用垂直裝載器（一個或兩個）半自動裝載
- 裝載鎖定室的加熱功能可供選擇

前驅物

- 液態、固態、氣態和臭氧
- 前驅物餘量感測器，提供清洗和填裝前驅物服務
- 4根獨立前驅物管線，最多可載入8個前驅物

*週期時間<10S
**不均勻性<1%

如欲瞭解更多資訊或報價，請隨時聯繫我們。

picosun
AGILE ALD

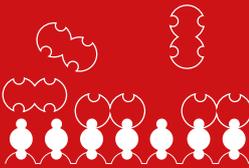
ALD的原理



引入含A元素的分子。



表面吸附分子。



引入含B元素的分子，
與表面的A元素反應。



形成AB化合物單分子層。

重複該過程，直至薄膜厚度符合預期。

picosun
AGILE ALD

PICOSUN總部

Picosun公司

地址：Tietotie 3

FI-02150 Espoo, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

Picosun公司

地址：Masalantie 365

FI-02430 Masala, Finland

電話：+358 50 321 1955

電子郵件：info@picosun.com

PICOSUN分公司

Picosun（歐洲）有限責任公司

電話：+49 1522 449 49 11

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（美國）有限責任公司

電話：+1 214 790 0844

手機：+1 214 490 3951

電子郵件：sales@picosun.com

新加坡Picosun（亞洲）有限公司

電話：+65 9756 3265

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（臺灣）有限公司

電話：+886 90 515 2985

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（中國）有限公司

電話：+358 40 480 3449

電子郵件：sales@picosun.com

Picosun（日本）有限公司

電話：+81 3 6431 9500

手機：+81 90 5198 8131

電子郵件：sales@picosun.com